

## บทที่ 7

### สรุป

1. โครงสร้างแบรกริเฟกเตอร์แบบสม่ำเสมอ (Uniform) ที่มีชั้นของสารกึ่งตัวนำแต่ละชั้นหนาเท่ากับ  $\frac{\lambda_0}{4n}$  เป็นโครงสร้างที่ให้ค่าการสะท้อนสูงที่สุดที่ความยาวคลื่นใช้งาน  $\lambda_0$
2. ค่าดัชนีหักเหของสารกึ่งตัวนำสองชนิดที่นำมาสร้างเป็นแบรกริเฟกเตอร์ ( $n_H$  และ  $n_L$ ) มีผลต่อคุณลักษณะการสะท้อนคือ เมื่อคิดที่จำนวนคู่เท่ากันแล้วถ้าสัมประสิทธิ์พิสัย  $\frac{n_H - n_L}{n_H + n_L}$  มีค่ามาก ลักษณะกราฟการสะท้อนที่ได้จะมีแบนด์วิดท์กว้างมากกว่าและค่าการสะท้อนสูงกว่า
3. เมื่อเพิ่มจำนวนคู่ของแบรกริเฟกเตอร์ให้มากขึ้นค่าการสะท้อนที่บริเวณความยาวคลื่นใช้งาน  $\lambda_0$  จะมีค่าสูงขึ้น และจะมีแบนด์วิดท์แคบลง
4. สำหรับโครงสร้างที่มีชั้นเลื่อนเฟส (Phase-shift layer) ถ้าชั้นเลื่อนเฟสนั้นมีความหนาเป็น  $\frac{k\lambda_0}{2}$  ( $k = 0, 1, \dots$ ) ค่าการสะท้อนที่ความยาวคลื่นใช้งานมีค่าต่ำ เนื่องจากเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกัน ถ้าชั้นเลื่อนเฟสมีความหนาเป็น  $\frac{(2k+1)\lambda_0}{4}$  ( $k = 0, 1, \dots$ ) ค่าการสะท้อนที่ความยาวคลื่นใช้งานจะสูงสุดเพราะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกัน และที่ความหนาอื่นๆ ค่าการสะท้อนสูงสุดเปลี่ยนไปอยู่ที่ความยาวคลื่นอื่นขึ้นอยู่กับความหนานั้นคือถ้ามีความหนา  $\phi$  มีค่าเป็น  $\frac{k\lambda_0}{2} < \phi < \frac{(2k+1)\lambda_0}{4}$  ค่าการสะท้อนสูงสุดจะเลื่อนไปทางความยาวคลื่นสั้น แต่ถ้ามีค่าเป็น  $\frac{(2k+1)\lambda_0}{4} < \phi < \frac{(k+1)\lambda_0}{2}$  ค่าการสะท้อนสูงสุดจะเลื่อนไปทางความยาวคลื่นยาว
5. ในโครงสร้างแบบไม่สม่ำเสมอที่สัดส่วนของ AI คงที่ อัตราส่วนของ  $d_H : d_L$  จะส่งผลกระทบต่อค่าการสะท้อนคือถ้า  $\frac{d_H}{d_L}$  มีค่าน้อยกว่า  $\frac{n_L}{n_H}$  ค่าการสะท้อนในช่วงความยาวคลื่นยาวจะลดลง แต่ถ้า  $\frac{d_H}{d_L}$  มากกว่า  $\frac{n_L}{n_H}$  ค่าการสะท้อนในช่วงความยาวคลื่นสั้นจะลดลง โดยเฉพาะแบรกริเฟกเตอร์คู่หน้าๆ อัตราส่วนนี้มีผลมากกว่าคู่ที่อยู่ถัดเข้าไป
6. สำหรับโครงสร้างแบบไม่สม่ำเสมอที่ทุกๆ คู่มือการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของ AI นั้นเป็นโครงสร้างที่กำจัดการสะท้อนช่วงความยาวคลื่นอื่นๆ นอกจาก  $\lambda_0$  ไปได้มาก ซึ่งมีลักษณะที่เป็นแบนด์สตอปไฟเตอร์ (Band stop filter) ทางแสง นั่นคือช่วงความยาวคลื่นอื่นๆ นอกเหนือจากช่วงใช้งานจะสามารถทะลุผ่านแบรกริเฟกเตอร์ได้ดี

7. เมื่ออ้างอิงกับโปรแกรม BRproject® แล้ว แบบจำลองที่สร้างขึ้นมาโดยวิธีโปรพาเกชันเมตริกซ์ (Propagation matrix) ให้ผลของการคำนวณที่ใกล้เคียงกัน และยังใกล้เคียงกับผลจากการทดลองอีกด้วย



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 8

### ข้อเสนอแนะ

ผลที่ได้จากวิทยานิพนธ์นี้ได้แสดงให้เห็นอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในโครงสร้างแบรกริเฟกเตอร์ ซึ่งตัวแปรแต่ละตัวนั้นมีผลต่อค่าการสะท้อนและการส่งผ่านที่สร้างจากสารประกอบกลุ่ม GaAlAs สำหรับแสงในช่วง  $1.3 \mu\text{m}$  ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวเหมาะสมการประยุกต์ใช้กับโครงสร้างควอนตัมดอทที่เกิดจากการก่อตัวของ InAs บนแผ่นผลึกฐาน GaAs ที่มีการเปล่งแสงช่วง  $1.3 \mu\text{m}$  เช่นเดียวกัน จากตัวอย่างโครงสร้างแบรกริเฟกเตอร์ที่ได้วิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์สามารถผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีการปลูกผลึกอพิแทกซ์จากสถานะไอและเทคโนโลยีจากลำโมเลกุล โดยข้อสังเกตสำหรับการประดิษฐ์ในแต่ละโครงสร้างดังนี้

(ก) โครงสร้างแบรกริเฟกเตอร์แบบสม่ำเสมอและโครงสร้างแบรกริเฟกเตอร์แบบที่ชั้นเลื่อนเฟสนิยมใช้คู่ของสารประกอบ GaAs/AlAs เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความคลาดของค่าสัดส่วนในสารประกอบ GaAlAs และที่สำคัญค่าอัตราการปลูกผลึกต้องมีค่าคงที่ตลอดการปลูก มิฉะนั้นค่าความคลาดของค่าความหนาจะผิดพลาดไปทำให้ค่าแถบการสะท้อนที่ได้มีความคลาดเคลื่อนไป และค่าอัตราการปลูกผลึกต้องมีค่าไม่ต่ำเกินไปนัก ซึ่งเป็นผลทำให้เวลาที่ใช้ในการปลูกนานเกินไป อันมีผลทำให้ความสม่ำเสมอของคุณสมบัติของผลึกที่ได้ในแต่ละชนิดของโครงสร้างมีความแตกต่างกัน โดยมีผลทำให้ผลที่ได้คลาดเคลื่อนไปจากที่ออกแบบได้

(ข) โครงสร้างแบรกริเฟกเตอร์แบบไม่สม่ำเสมอ (Chirped or Rugate) โครงสร้างนี้สามารถประดิษฐ์สร้างได้ยากในทางปฏิบัติ วิธีการที่สร้างทำให้ได้โครงสร้างดังกล่าวมีความจำเป็นต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการคำนวณเพื่อกำหนดค่าสัดส่วนของ GaAlAs ค่าความหนา จากนั้นนำค่าสัดส่วนและค่าความหนาไปคำนวณหาค่าฟลักซ์หรืออัตราการไหลของก๊าซและเวลาที่ใช้ในการปลูกในแต่ละชั้น ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบค่าฟลักซ์ ค่าสัดส่วนของ GaAlAs และค่าความหนาของผลึกที่ปลูกได้มีความสำคัญสำหรับการประดิษฐ์สร้างโครงสร้างดังกล่าว ตัวอย่างเช่น RHEED Oscillation [9], spectroscopic ellipsometry [10], Optical-based flux monitor (OFM) [11] เป็นต้น

เนื่องจากโครงสร้างแบรกริเฟกเตอร์นั้นเมื่อคำนวณค่าความหนาของแต่ละโครงสร้างมีความหนาประมาณ  $5 \mu\text{m}$  สำหรับ GaAs/AlAs จำนวน 25 คู่ที่มีค่าความยาวคลื่นแบรกที่  $1.3 \mu\text{m}$  หากใช้ค่าอัตราการปลูกผลึก  $0.5 \mu\text{m}/\text{ชั่วโมง}$  ต้องใช้เวลาปลูกเป็นเวลา 10 ชั่วโมง สำหรับการปลูกผลึกด้วยวิธีการปลูกผลึกจากลำโมเลกุลที่วัสดุที่อยู่ในรูปของแข็งสถานะสำหรับบรรจุสารต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ มิฉะนั้นค่าฟลักซ์มีค่าไม่ตรงที่ได้ อันทำให้ค่าความหนาที่ได้เกิดความไม่

สม่าเสมอขึ้น และในกรณีที่เป็นสารประกอบ GaAlAs ค่าสัดส่วนและความหนาที่คลาดเคลื่อนไปด้วยเช่นเดียวกันจากการเปลี่ยนแปลงค่าฟลักซ์ของสารโคสารหนึ่งหรือทั้งสองชนิด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างแบรกริเฟเตอร์จึงไม่นิยมใช้วิธีการปลูกผลึกจากลำโมเลกุลที่ใช้วัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีของการปลูกผลึกจากลำโมเลกุลที่ใช้วัสดุที่อยู่ในรูปของแข็งได้มีการพัฒนาให้ Effusion มีขนาดของบรรจุสารต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นที่ที่สามารถปลูกผลึกได้ในอัตราการปลูกผลึกที่สูงกว่า  $0.5 \mu\text{m}/\text{ชั่วโมง}$  และมีค่าฟลักซ์คงที่นานกว่า 200 ชั่วโมง



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย